

# 第80回応用物理学会秋季学術講演会シンポジウム 「アトミックレイヤープロセスの最新動向」

日時: 2019年9月20日(金) 13:30-18:00(予定)  
会場: 北海道大学(応用物理学会会場内)

2019  
9/20  
(金)

半導体デバイスの微細化・高度化に伴い、原子レベルでの3次元微細加工を可能とする原子層堆積(ALD)法や原子層エッチング(ALE)法が高く注目されています。本シンポジウムでは、産官学の研究者が一堂に会し、表面化学・反応工学を基にした原理からデバイス応用まで、AI・機械学習や材料インフォマティクスを含めた最新の動向を昨年に引き続き広く議論します。

## 【招待講演者】(予定・仮題)

霜垣幸浩 (東京大学) 「ALDプロセス開発の課題とデータサイエンスへの期待」  
知京豊裕 (物質・材料研究機構)

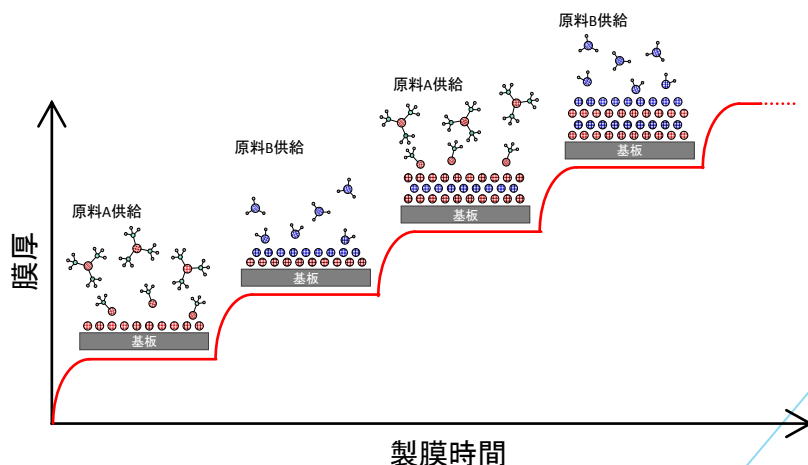
「マテリアルズインフォマティクスの視点からみたALDとALE」

光成正 (東京エレクトロン) 「原子層成膜プロセスの次世代制御手法」

廣瀬文彦 (山形大学) 「室温原子層堆積法の開発とガスバリア応用」

唐橋一浩 (大阪大学) 「ビーム実験による原子層プロセス反応解析」

伊澤勝 (日立ハイテクノロジーズ) 「表面反応制御による高選択Conformal ALE」



【世話人】 関根 誠(名古屋大学)、百瀬 健(東京大学)

※一般講演募集中(6月25日17時締切)

※協賛募集中(プログラム記載、会場での資料配布および展示)